News Letter

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ

米国・Applied Materials社と同社の研究施設「META Center」における共同開発契約を締結

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズはこのほど、Applied Materials, Inc.（本社：米国・カリフォルニア州サンタクララ／以下、Applied Materials社）との間で、Applied Materials社の新たな研究開発拠点であるMaterials Engineering Technology Accelerator（META Center）でのプロセス開発におけるコラボレーション契約を締結しました。この合意により、当社のウエハー洗浄技術に関する専門的知見と、マテリアルズ エンジニアリングのソリューションにおけるApplied Materials社のリーダーシップとの相乗効果によって技術開発を推進します。

締結式の模様
右：Applied Materials社
Advanced Product Technology Development担当
Vice President Ellie Yieh氏
左：当社 代表取締役 社長執行役員 後藤 正人

☆この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、
下記URLよりダウンロードできます。
（www.screen.co.jp/about/nr-photo_2020）

Applied Materials社のMETA Centerは、ニューヨーク州アルバニーにあるNY-CREATES（Research, Economic Advancement, Technology, Engineering and Science：研究、経済発展、テクノロジー、エンジニアリング、サイエンスのためのニューヨークセンター）のキャンパス内に位置し、新しいチップ材料やプロセス技術、デバイスの試作を加速する目的で設けられた専門施設です。今回の合意により、当社は枚葉式洗浄装置「SU-3200」をMETA Centerに納入、Applied Materials社は当社にパターン付きウエハーのテスト環境を提供し、評価を行います。当社の「SU-3200」は、META Center内で稼働しているApplied Materials社の最新のプロセスシステムと連携し、前後のプロセスに最適な洗浄技術の構築を推進します。

当社の代表取締役 社長執行役員である後藤正人は「成膜、エッチング、イオン注入をはじめ、最先端プロセスに対する洗浄技術の最適化を行うMETA Centerにおいて、Applied Materials社とコラボレーションできることは、当社にとって非常に有益であると考えています。META Centerのような最先端施設における技術開発が、われわれのお客さまに対するより価値の高い半導体プロセスの提供に寄与することは間違いありません」と、本プロジェクトに大きな期待を寄せています。

また、Applied Materials社New Markets and Alliances GroupのAdvanced Product Technology Development担当Vice PresidentであるEllie Yieh氏は、「SCREENセミコンダクターソリューションズのウエハー洗浄装置により、META Centerの機能と、研究から製造までの新技術の開発を加速させるためのリソースが強化されました。最先端のチップ開発におけるプロセスの最適化を目的としたMETA Centerにおける、SCREENセミコンダクターソリューションズをはじめとした企業とのコラボレーションに期待しています」と述べています。

Doc. No.: SPE200114J

■ **株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ**

京都市に本社を置くSCREENセミコンダクターソリューションズは、長年培ったエッチングおよびフォトリソグラフィーをコア技術に、1970年代に半導体製造装置市場に参入。洗浄装置事業では、ますます重要度が高まる洗浄プロセスで確固たるシェアを築いています。顧客視点を起点としたイノベーションを続け、高品質な製品やサービスを通じてお客さまの事業に貢献し続けることを基本方針としています。

詳しい情報は www.screen.co.jp/spe をご覧ください。

● **本件についてのお問い合わせ先**

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ　マーケティング部　Tel: 075-417-2527　speinfo@screen.co.jp

Doc. No.: SPE200114J